研究スタッフ

准教授: 角田 齊藤 教 授: 匡清 伯、 教: 小川 智之、技術職員:小野寺 政信 助 研究員: 飛世 正博、日向 慎太朗



本研究室では、スパッタ法を中心としたドライプロ セスならびに化学合成を中心としたウェットプロセス を駆使することによって、超高密度磁気記録媒体、高 性能・高感度を有するMRAM・SVヘッドおよび高周 波デバイスを実現し得る、新たな材料設計・プロセス 技術の確立を目指している。

主な研究テーマ

Composition modulated atomic layer stacking for high-K₁₁ material $Co_{80}Pt_{20}$ (T_{sub} = const. 300 °C, P_{Ar} = 2.0 Pa) HAADF-STEM images HAADF-STEM Incident electron ray iameter: Co₈₀Pt₂₀ Sample

HDD beyond 1 Tb/inch^D



Media structure for perpendicular recording

In-line UHV sputtering machine





Ru

Composition modulated atomic layer stacking (Pt poor/rich) are formed.





Image: Atom position

+ compositional contrast

Scattered ray

 $H_2O < 1 \text{ ppb}$ Oil-free pump Base P: 1 × 10⁻⁸ Pa

Fcc stacking as faults in macroscopic of hcp phase accompanies with irregularities for the periodicity of the compositional modulation



Dot diameter (nm)

Ordered-arrangement structure by a self-assemble phenomenon

齊藤・角田研究室

http://www.ecei.tohoku.ac.jp/electronic_physics/

Spin nano technology for high performance magnetoresistive random access memory Ta 3 nm Ru 0.9 nm Co₆₅Fe₃₅ 4 nm **Co_{100-x}Fe_x** 0.5 nm BCC **FCC** $L1_2$ -Mn₃Ir 10 nm MRAM Spin-RAM 2-11/13/ Ru 10 nm Ta 5 nm $J_{\rm k}~({\rm erg/cm}^2)$ 0.8 Si/SiO2 γ -Mn₇₇Ir₂₃ 0.6 current Ta 1 nm Ru 1 nm Co₅₀Fe₅₀ 3.5 nm A ANA **Co_{100-x}Fe_x** 0.5 nm Électric (Pin -FM γ-Mn₇₇Ir₂₃ 10 nm AFM Ru 5 nm Ta 4 nm 20 40 60 80 10 Si/SiO2 Fe content in Co-Fe layer (at.%) Enhanced exchange bias property with ultra-thin insertion layer $T_{a} = 360^{\circ} C$ psi target Newly developed process 360°C Post annealed **As-deposited.** cess Та (C)(a)



Single phase NPs formation with gram scale !!

Challenge to GHz-band magnetic response

















http://www.ecei.tohoku.ac.jp/electronic_physics/

 $\sim\sim\sim\sim\sim$